This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(to be used for	RANSMITTAL FORM all correspondence after initia	Examiner Name Attorney Docket Number
Total Number of	f Pages in This Submission	OTMP0054USA
Amendman Ame	smittal Form ee Attached ent/Reply fter Final ffidavits/declaration(s) n of Time Request Abandonment Request on Disclosure Statement Copy of Priority tt(s) e to Missing Parts/ te Application esponse to Missing Parts ander 37 CFR 1.52 or 1.53	ENCLOSURES (Check all that apply) Drawing(s)
Firm	1	ATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT
or Individual name	Winston Hsu, Reg.	No.: 41,526
Signature	-6	I hard And
Date	12	1812002
		ERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING
sufficient postage the date shown be	at this correspondence is as first class mail in an e elow.	being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with evelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on
Typed or printed i	name	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

PTO/SB/17 (10-03)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

	TDA	NICMA	ITT	- A I
FEE	TRA			AL
			. 4	
	for F`	Vツロロ	14	
	IOI I	LUU	7	

(\$) 0.00

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

Application Number	10/707,280	
Filing Date	12/03/2003	
First Named Inventor	Wen-Ching Ho	
Examiner Name		
Art Unit _		
Attorney Docket No.	OTMP0054USA	

Complete if Known

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)		FEE CALCULATION (continued)						
Check Credit card Money Other No				ONAL		S		
Deposit Account:	ŗ	arge E	ntity	Small	Entity			
Deposit Account 50-0801	- 1	Fee Code	Fee (\$)	Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid	
Number		1051	130	2051		Surcharge - late filing fee or oath		
Deposit Account North America International Patent Office		1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet		
Name The Director is authorized to: (check all that apply)		1053	130	1053	130	Non-English specification		
Charge fee(s) indicated below Credit any overpaymen	ts	1812	2,520	1812 2	2,520	For filing a request for ex parte reexamination		
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	ŀ	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee		1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after		
to the above-identified deposit account.	_					Examiner action		
FEE CALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month		
1. BASIC FILING FEE		1252	420	2252	210	Extension for reply within second month		
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description Fee Pai		1253	950	2253		Extension for reply within third month		
Code (\$) Code (\$)	" I	1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month		
1001 770 2001 385 Utility filing fee	¬I	1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month		
1002 340 2002 170 Design filing fee	∃I	1401	330	2401	165	Notice of Appeal		
1003 530 2003 265 Plant filing fee	71	1402	330	2402	165	Filing a brief in support of an appeal		
1004 770 2004 385 Reissue filing fee]	1403	290	2403	145	Request for oral hearing		
1005 160 2005 80 Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding		
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	71	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISS		1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional		
Fee from		1501		2501	665	Utility issue fee (or reissue)		
Extra Claims below Fee Partocal Claims below Fee Partocal Claims		1502	480	2502		Design issue fee		
Independent 231	-11	1503	640	2503		Plant issue fee		
Claims - 3 - 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	╡	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner		
	~	1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)		
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description		1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt		
Code (\$) Code (\$)		8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)		
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3		1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection		
1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not pa	1	1810	770	2810	205	(37 CFR 1.129(a)) For each additional invention to be	 	
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims		1010	770	2610	365	examined (37 CFR 1.129(b))		
over original patent	ı	1801	770	2801	385	Request for Continued Examination (RCE)		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent		1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application		
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	$\neg \mathbf{I}$	Other	fee (sp	ecify) _				
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	,-I	*Redu	ced by	Basic F	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00		

SUBMITTED BY (Complete (if applicable)) Registration No. Name (Print/Type) Winston Hsu 41,526 Telephone 886289237350 Date Signature

> WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
091220193	Taiwan R.O.C	12/09/2002		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 <u>2002</u> 年 <u>12 月 09</u> 日 Application Date

申 請 案 號: 091220193 Application No.

申 請 人:中強光電股份有限公司 Applicant(s)

局

長

Director General







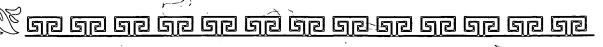
發文日期: 西元 2003 年 7 月 10 日

Issue Date

發文字號:

09220698010

Serial No.



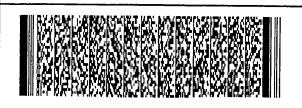
申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

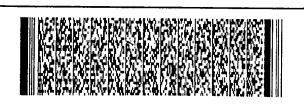
(以上各欄	由本局填	新型專利說明書
. –	中文	光閥調整裝置
新型名稱	英文	Adjusting apparatus for light valve
	姓 名 (中文)	1. 何文卿
-	姓 名 (英文)	1. Ho Wen-Ching
創作人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 新竹科學工業園區新竹市力行路11號
	住居所(英文)	1. No 11, Li Hsing Rd, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 中強光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. Coretronic Corporation
Ξ	國 籍 (中英文)	1. 中華民國
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹科學工業園區新竹市力行路11號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No 11, Li Hsing Rd, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 張威儀
	代表人 (英文)	1. Wade Chang

四、中文創作摘要 (創作名稱:光閥調整裝置)

陸、英文創作摘要 (創作名稱:Adjusting apparatus for light valve)

An adjusting apparatus for light valve comprises a substrate, two sets of adjusting modules having a reposition module, and a light valve clipped between the adjusting and reposition module. The position of the light valve is adjusted by the adjusting module and repositioned by the reposition module. Two sets of adjusting modules are placed on the same surface of the substrate to be adjustable the X and Y-axis movements of the light valve. Therefore, the adjusting apparatus can decrease its thickness and volume.





四、中文創作摘要 (創作名稱:光閥調整裝置)



- 伍、(一)、本案代表圖為:第___ 圖
 - (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

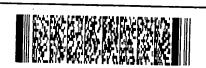
調整裝置 10 基板 11 第一調整模組 12 第一復位模組 13

第二調整模組 14 第二復位模組 15

陸、英文創作摘要 (創作名稱:Adjusting apparatus for light valve)



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案 號	主張專利法第一百零五條準用 第二十四條第一項優先權
、□主張專利法第一百	零五條準用 第二十	五條之一第一項係	多牛梭。
申請案號:	, ,	—),,	とノロイ性・
日期:			
、主張本案係符合專利;	法第九十八條第一	項□第一款但書或	.□第二款但書規定之期間
日期:			
			•



五、創作說明 (1)

【新型所屬之技術領域】

本創作係有關調整裝置,尤其係指一種應用於投影顯示裝置中調整光閥位置之光閥調整裝置。

【先前技術】

請參閱第1圖及第2圖所示,習知光閱固定裝置係 先將一光閱1嵌設於一夾持件2內,再將夾持件2容置 於一光機殼體3一端之容槽4內,最後將印刷電路板(Printed Circuit Broad,PCB)(圖未示)貼設於光 閥1外側作電路連結,並鎖固於光機殼體3之螺孔5上 ,因此,光閥1組裝後即不可調整位置。

但是,投影系統中光閥之位置,直接影響到光源提供之光束投射於光閥表面之精確性,因此,於組裝過程中,定位後之光閥必須再進行精確調整,使光束能準確投射於光閥表面,確保高照明效率及提高影像品質。

【新型內容】

本創作之一目的,係提供一種光閱'調整裝置,利用旋轉調整元件推動滑座調整光閱位置,以及搭配彈性元件彈力回復,以達到簡易調整光閱位置。

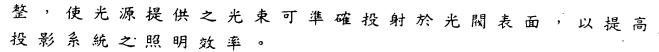
本創作之另一目的,係提供一種光閥調整裝置,利用滑座及固定座之搭配,使不同位移方向之調整模組可設置於同一平面上,因此,可達到縮簡調整裝置之厚度及體積。

本創作之又一目的,係提供一種光閥調整裝置,可裝設於投影系統之光機引擎中,而提供光閥進行位置調





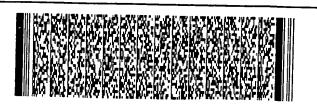
五、創作說明 (2)



【實施方式】

有關本創作為達到上述目的,所採用之技術手段及其餘功效,茲舉一較佳實施例,並配合圖式加以說明如下:

請參閱第3圖所示,本創作光閱調整裝置10包括一基板11、一組相配合之第一調整模組12與第一復位模組13,另一組相配合之第二調整模組14與第二復位模組15,以及一光閥16,例如數位微鏡片裝置(Digital Micro-mirror Device,DMD)等,光閥





五、創作說明 (3)

16條夾持於調整模組12、14與復位模組13、15間。

參閱 第 4 圖所示, 其中該基板 1 1包括一表面 相 應 光 閥 1 6 開 設有 2 及 第 復位模組 1 面 1 上 相 對 端 第 部 固 型滑 2 2 座 1 2 固 定 1 係 固 設於 基板 1 面向光閥 1 6 之 側 面 開 設有 凹 1 1 1 置於凹槽 1 2 1 1 內 且 滑 1 2 2 1 相對應之表面 上分設有 配合之導 相 1 2 2 1 3 亦可於滑 1 2 2 座 與 固 定座 1 2 1 相 導 柱 及 槽 且 3 1 1 長 度方向係 2 1 3 位移方向 該 調 元 件 1 2 設於固定座 1 1 且一端 抵制於 2 2 滑 座 1 且位移 X 軸 向 2 藉 由旋轉 調 元件 1 3 以推動滑 X軸向位移而推動 光 1

第 一復位模 組 包 括 固 定座 1 至 3 1 性元件 3 其 中 国 面 1 1 1 並於面向光 凹 1 3 1 滑 座 1 2 係容 置於凹槽 且滑 3 2 1 與 1 1 相 對 應 之表面 1 3 2 1 1 1 亦可於滑 2與固定座 3 1 相對應之表面上分設有導柱及導 1





五、創作說明 (4)

且導槽 1 14長度方向係平行於另 1 1 3 性元件 1 3一端連接於 固 定 座 1 3 1 3 2 3 端抵制於滑座 1 彈性元件 3 1 (如第 4 圖所示) 或彈片 第 (如)

,係另一組相配合之第二調 再參閱第4圖所示 1 4 及第 二復位模組1 5 ,係設於基板1 1 上相對端 且方向與 部 第 調 整 2 模 組 1 及 第 3 直 第 _ 整 模 組 1 4 包 括 国 定座 1 4 2 3 1 4 其 元 件 中 占 固設於基板 1 1 表 1 面 1 1 並 向 於 面 光 開設有 一凹槽 1 4 1 1 2 滑 座 1 4 係 容 置於 1 1 2 內 且 滑 座 1 4 與基板 1 1 相對應 之表面 設有相配合之導 2 柱 1 1及導槽 4 1 1 5 亦可於 4 固 定座 1 4 1 相對應之表面上分設有 且 5 1 1 長度方向係平行於調整元件 該 調 整 元 件 1 4 3 係螺設於固定座 一端抵制於 2 滑 座 1 4 , 且位移方向平行於一 元 件 1 4 3 以推動滑座 1 4 2 沿 位移以推動光閥 1 6

第二復位模 組 1 5 包括 一固定座 1 5 5 3 性 元 件 1 其 中 占 定 座 1 5 1 表 面 1 1 1 並於 面向光 閥 1 6 之侧 面 開 1 一凹槽 5 1 1 滑 座 1 5 2 係容置於凹槽 1





五、創作說明 (5)

且滑座 內 與基板 1 1 相 對應 之表面上分設有 2 1 及 導 1 1 6 亦 可於滑 對 應 之表面 上 分設 有 柱及 且 向 係平行於 5 度 端 連 5 接 定 2 1 性元件 3 1 5 為 具 可 彈 嗧 或

此 光 閥 1 6 係設於 占 定板 1 6 1 固 定 板 四 通 孔 1 6 1 1 占 定 元 6 螺 1 設於 基 板 1 1 固 之 軸 徑 係 於 通 孔 小 徑 定 6 1 偏 可 移 固定 板 2 組 第 復位模 3 組 5 所 圍 容 置 空 定板 置 座 1 2 2 3 2 於 1 4 1 之 Z軸向位移 以'及 1 1 5 2 側 面 分 别 抵 制 固 定 同 固 定 5 昌 及 第 В 圖 X 軸 2 3 時 2 同 6 X 軸 固 1 1 沿 時 固 1 另 側 座 1 3 2 而 使 達 到 固 定 板 1 6 1 之 X軸向位置 反之 ,反向旋轉 整元件 調





五、創作說明 (6)

受壓之彈性元件 3 3 藉由彈力回復推動滑座 1 2 1 致使固定板1 6 1 沿 X軸反向位移 0 另 外 旋 3 4 盽 其一端推動滑座 1 4 同時 1 Y 沿 軸向移 動 此時固 定 板] 6 1 性元件 5 3被壓縮 1 使設於 固 定板 上之光閥 6 1 進行 Y 軸向位置 調 整 反之 反向旋轉 整元件 3 1 4 受 壓之彈性元件 5 3 1 藉 由 彈力回復 2 1 致使固 定 板 1 -6 1 沿 Y軸反向位移 光閥 1 6 連結於固定板 1 6 1 上後, 藉由旋轉 2 3及Y軸調整元件 元 件 1 1 4 3 以及彈性元件 3 之復位,即可提供光閥之二維方向位置調 5 1 整

另外,本創作所採用兩組搭配復位元件之調整模 分別調整光閥之X軸向及Y軸向 ,即第一調整模組 配第一復位模組1 3調整光閥X軸向, 第二調整 4 搭配第二復位模組 1 5 光閥Y'軸向 調 整 且每 1 1 4均設於 基板 1 1 之同一 表 面 1 1 由設 2 2 3 滑 座 1 1 2 1 2 5 4 1 固定板 1 6 1 以調整光閥 1 6 位 置 因 此 面上進行二維方向之位置調整 故可縮簡調整裝置之 , 厚度及體積

本創作之光閥調整裝置10搭配裝設於投影系統之光機引擎(圖未示)中,組裝後之光閥可藉由本創作光閥調整裝置10調整光閥位置,使光源提供之光束可準





五、創作說明 (7)

確投射於光閥表面,以提高投影系統之照明效率及影像品質;另外,由於本創作之光閥調整裝置10可於同一平面上進行二維方向之位置調整,故其厚度較為縮減,因此,裝設於投影系統中可簡化其整體體積。

以上所述,僅用以方便說明本創作之較佳實施例,本創作之範圍不限於該等較佳實施例,凡依本創作所做的任何變更,於不脫離本創作之精神下,皆屬本創作申請專利範圍。



圖式簡單說明

【圖式簡要說明】

- 第1圖,係習知光閥固定裝置之立體圖。
- 第2圖,係習知光閥固定裝置之爆炸圖。
- 第3圖,係本創作光閥調整裝置之立體圖。
- 第4圖,係本創作光閥調整裝置之爆炸圖。
- 第5 A 圖,係本創作光閥調整裝置之俯視圖。
- 第5 B 圖,係本創作第5 A 圖之 A A 剖視圖。
- 第6圖,係本創作採用彈片之光閥調整裝置爆炸圖

【圖號簡要說明】

- 調整裝置
- 基板
- 表面
- 窗口
- 導 槽
- 螺孔
- 容置空間
- 第一調整模組
- 固定座
- 凹槽
- 滑座
- 導 柱
- 調整元件
- 第一復位模組
- 固定座

- 1 0
- 1 1
- 1 1 1
- 1 1 2
- 1 1 3 、 1 1 4 、 1 1 5 、 1 1 6
- 1 1 7
- 1 1 8
- 1 2
- 1 2 1
- 1 2 1 1
- 1 2 2
- 1 2 2 1
- 1 2 3
- 1 3
- 1 3 1



圖式簡單說明

凹	槽						1	3
滑	座	•					1	3
導	柱						1	3
彈	性	元	件				1	3
笙	_	調	紋	档	źĦ		1	1

1 1

2

3

1

1

_	調	整	榠	組			1	4	
定	座						1	4	1
槽							1	4	1
座							1	4	2
	定槽	定座槽	定座槽	定座槽	定座槽	槽	定座槽	定 座 1 槽 1	定座 1 4 槽 1 4

草	柱						1	4	2	1
凋	整	元	件				1	4	3	
*	_	/石	/_	144	4-		4	_		

第	=	復	位	模	組		1	5		
割	定	座					1	5	1	
可	槽						1	5	1	1
骨	座						1	5	2	
草	柱						1	5	2	1

亭	柱					1	5	2	
彈	性	元	件	•		1	5	3	
光	閥					1	6		

固定板	1	6	1	
通 孔	1	6	1	1
固定元件	1	6	2	

六、申請專利範圍

- 1、一種光閥調整裝置;包括:
 - 一基板, 係具有一表面;
 - 至少一調整模組,係固設於該表面上一端;
 - 至少一復位模組,係固設於該表面上另一端且相對於該調整模組; 以及
 - 一光閥,係夾持於該調整模組與復位模組間。
- 2、如申請專利範圍第1項所述之光閥調整裝置,其中該調整模組包括一固定座、一滑座及一調整元件,該固定座固設於基板表面,面向光閥之一側開設有一凹槽,該滑座係容置於該凹槽內,該調整元件係螺設於固定座且一端抵制於該滑座。
- 3、如申請專利範圍第2項所述之光閥調整裝置,其中該調整模組滑座與基板相對應之表面上分設有導柱及導槽。
- 4、如申請專利範圍第2項所述之光閥調整裝置,其中該調整模組滑座與固定座相對應之表面上分設有導柱及導槽。
- 5、如申請專利範圍第2項所述之光閥調整裝置,其中該復位模組包括一固定座、一滑座及至少一彈性元件,該固定座固設於基板表面,該彈性元件一端連接於固定座,另一端抵制於滑座。
- 6、如申請專利範圍第5項所述之光閥調整裝置,其中該復位模組滑座與基板相對應之表面上分設有導柱及導槽。



六、申請專利範圍

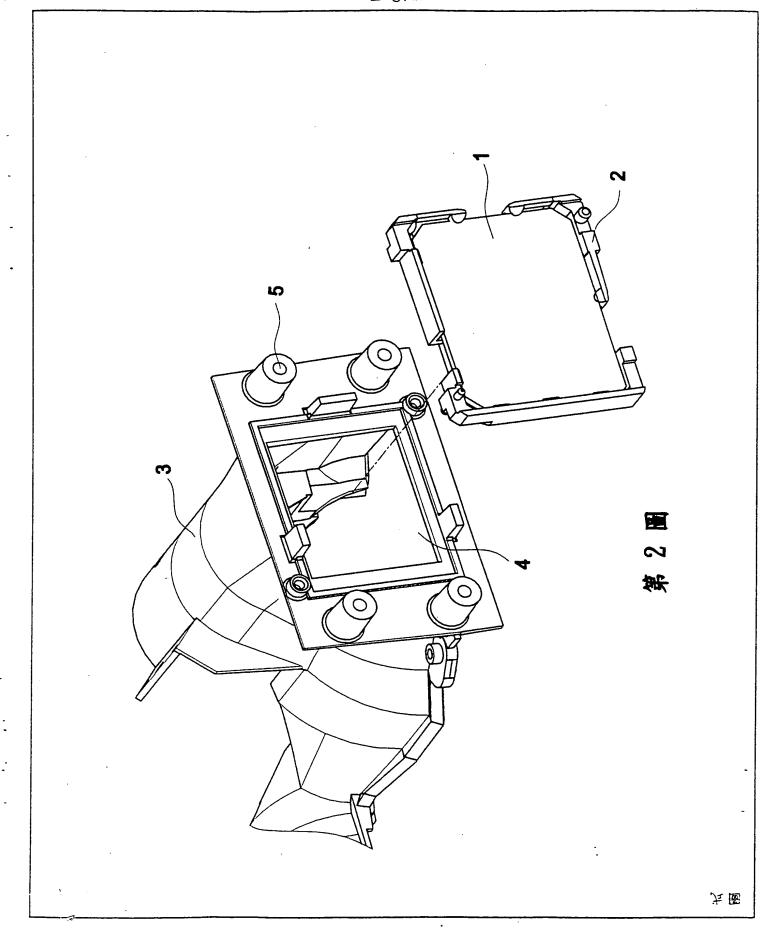
- 7、如申請專利範圍第5項所述之光閥調整裝置,其中該復位模組滑座與固定座相對應之表面上分設有導柱及導槽。
- 8、如申請專利範圍第5項所述之光閥調整裝置,其中該彈性元件可為彈等。
- 9、如申請專利範圍第5項所述之光閥調整裝置,其中該彈性元件可為彈片。
- 10、如申請專利範圍第5項所述之光閥調整裝置,其中該調整元件之位移方向係平行於彈性元件之彈性變形方向。
- 11、如申請專利範圍第5項所述之光閥調整裝置,其中該光閥係設於一固定板上,且調整模組之滑座與復位模組之滑座其一側面係抵制於固定板之側面。
- 12、如申請專利範圍第1項所述之光閥調整裝置,其中該調整模組包括第一調整模組及第二調整模組,且於復位模組中設有相對應之第一復位模組及第二復位模組。
- 13、如申請專利範圍第12項所述之光閥調整裝置, 其中該第一調整模組與第二調整模組係於同一平面 移動者。
- 14、如申請專利範圍第12項所述之光閥調整裝置,其中該第一調整模組之位移方向與第二調整模組之位移方向係相互垂直者。
- 15、如申請專利範圍第1項所述之光閥調整裝置,其

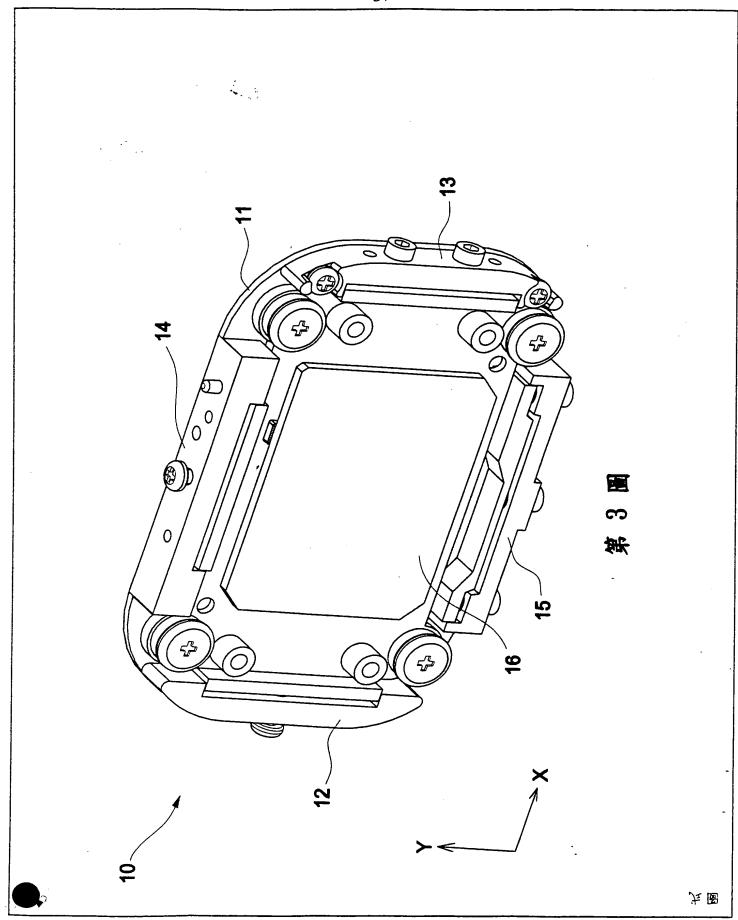


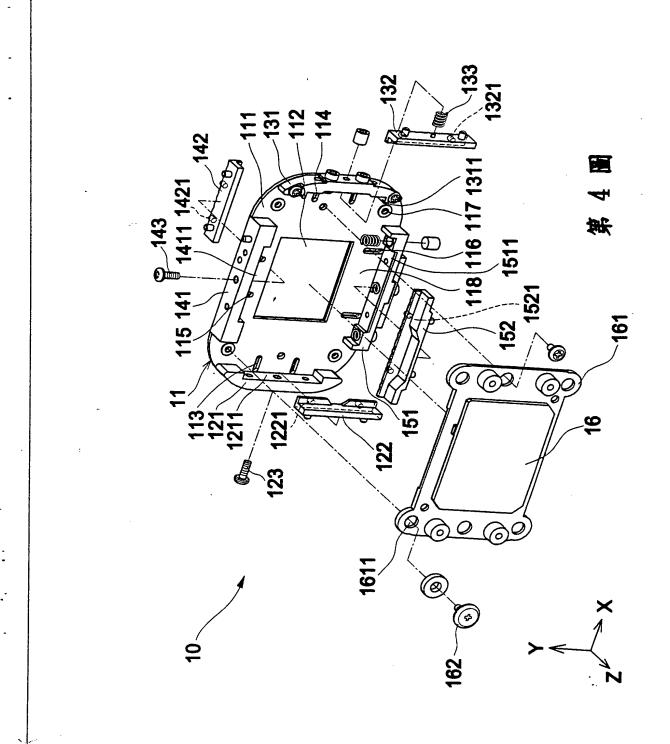
六、申請專利範圍

中該調整模組及復位模組係於同一平面移動者。









法圖

